(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—125865

①Int. Cl.³ H 01 L 27/14 G 01 J 3/00 H 01 L 31/10 庁内整理番号 6819-5F ❸公開 昭和58年(1983) 7月27日

6819-5 F 7172-2 G 7021-5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

多感光装置

20特

願 昭57-9197

②出 願 昭57(1982)1月22日

79発 明 者 桑野幸徳

守口市京阪本通2丁目18番地三

識別記号

洋電機株式会社内

仍発 明 者 中野昭一

守口市京阪本通2丁目18番地三 洋電機株式会社内

70発 明 者 武内勝

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

⑪出 願 人 三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

切代 理 人 弁理士 佐野静夫

49 AL W

- L 発明の名称 略 先 替 僧
- 2. 特許前求の範囲
- (2) 前記アセルファス半導体を主機収要案とする配光領域は特定投長域の光相射化より光起電力を発生することを特徴とした特許請求の範囲第1項記載の必先任候。
- (a) 初記アセルファス半導体を主機収長業とする感光循域は特定会長域の光線射化より導電率が 上昇することを特徴とした特許請求の範囲第1項 記載の感光伝達。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は複数の特定要長級に膨光する膨光接機

に関する。

光活性層に単結晶シリコンを用いた複数の特定 **食長域に感光する感光装置、所謂色センサーの存** 在は既に知られている。その原理的な構成は、毎 1 図に示す如く、単粒品シリコン基板(1)の表面に 複数の膨光循域であるフォトダイオード領域(2) R) (2G) (2B) を数けると共に、これら各 領域上に造過収長域の異なる光学フィルタ。 例え は赤色フィルタ(SR)、緑色フィルタ(SG) 及び青色フィルタ(3B)を配し、更にその上に 赤外カットフィルタ(4)を配したもので、斯るセン サー化於いて、各フィルタ(3R)(3G)(3 B)(4)を介して可視光が基板(1)に入射すると、入 射可視光の含む色に応じて、それが訳をら赤色で イルタ (3 R) 化対応したフォトダイオード単塚 (2R)に、最なら数色フィルタ(ろり)に対応 したフォトダイオード領域(2G)に、また青た 5青色フィルタ(3B) 化対応したフォトダイオ ード伽城(2B)に夫々信号が出力される。 単結晶シリコン自体の感光度特性は易2節の曲

-265-

特開昭58-125865(2)

線 A 化示す如く、赤外領域にピークを呈する。一 方。赤色フィルタ(3R)は赤色帯域で最過度の ピークを示すものの、その帯域特性の拡がりは減 衰しながらも赤色領域にまですそ野を引いている。 従って、光活性着化単結晶シリコンを用いた場合、 赤色フィルタしるR)を過すだけではフォトダイ オード領域(2R)は、減費しながらも共に入射 する赤外光に、単結晶シリコン自体の膨光度特性 化広じて強く感応してしまい。正確な色情報を検 出てきたい。前記従来の色センサー化於ける赤外 カットフィルタ(4)は、この様な入射赤外光を除去 するために設けられており、不可欠な存在である。 然し乍ら、斯る赤外カットフィルタ(4)の存在は センサーの構成を複雑にするだけでなく、製造に 際して、そのフィルタ(4)並びに各色フィルタ(3 R) (5 G) (5 B)を単結晶シリコン基板(1)上 に重量被増する工程で、競鋼をシリコン基板(1)を 破損しやすい。といった欠点をもたらす。

本発明は斯る点に鑑みて為されたものであって、 以下に本発明の実施例につき許述する。

ものが知られており、更にこれらの物質中に水素やハロゲン元素、あるいはドーパントとして砒素(AB)・講印・ポロン四・アルミニウム(AL)を含むものが適用される。斯るユーS1系)のあ光度特性は毎2回回に示す如く可視光域に可能を対する。この感光度特性はPINの感光度特性はPINのをででする。この感光度特性はPINの自己の光活性増(13R)(13G)(13日)のものであり、従来の如く年結晶ショコとの感覚にファイルが示外領域に存在することに知らしてものであり、従来の相くない極めて重要な特性な、赤外領域に対し感光しない極めて重要な特性を具備している。

(15R)(15G)(15B)は和記悉光性 基板40の他方の主面に於いて明記3番の発光報域 (11R)(11G)(11B)の天々に対向す べく配置せしめられた赤色・緑色・青色フィルタ で、これ等の各色フィルタ(15R)(15G) (15B)は赤・緑・青の各色の特定数長域の可

第3図(NIB)は本発明の一実施例である色センサ - の光報射像から見た正面図世びにB―E繰新面 園である。 角図に於いて、50はガラス・耐熱プラ スチック等の遊光性基板。(11R)(110) (11B)は脳配蓋光性基板QQの一方の主面に数 けられた複数例えばる個の感光領域で、収膨光節 键(11R)(11G)(11B)は前記遊光性 基板(I) 典から遊光性電磁(12R)(12G)(12B)、アモルファス半導体から収る光活性層 (13R)(13G)(13B)、及び金属電磁 (1 AR)(1 4 G)(1 4 B)を推薦した被迫 を持つ。前記光括性間(15R)(15G)(1 3B)を構成するアモルファス半導体としては、 グロー放電等のガス反応を用いて任意の表板上に 参収されるアモルファスシリコン(8-S1)・ ナモルフェスシリコンカーパイド(B - S 1 C) · アセルファスシリコンゲルマニウム(& - Si Ga)・アモルファスシリコンナイトライド(8 -S1N)・アモルファスシリコンスズ(& - S 151)及びそれらを蟄結品化したもの等様々の

説光を意過せしめるもので着色ガラス収いは着食 有機機脂等により構成され、初紀各色フィルタ(15尺)(15Q)(15B)は一体化されたも のであっても失い。

節して、初紀光活性増(15R)(150)(1 5 B) 水、 P N 被合· P I N 被合· P I 被合· I お扱合・ショットキー液合・ヘテロフェイス扱 合・絶象器を介したMIS 語合等の扱合型のもの にあっては、赤色・最色・青色の各色フィルタ(15R)(15G)(15B)で選択された特定 数長域の光報射により自由状態の電子及び又はホ - ルを生ぜしめ、それらが夫々の遊光性育研(1 2R)(12G)(12B)及び金属電板(14 R)(140)(14B)に和論して韓電板(1 2R)(14R) - (12G)(14G) - (1 2B)(148)酸に光冠電力を発生する。一方、 光括性器(13尺)(15日)(15日)が上述 の如き抜合を有しないものだあっては目由状態の……-世子及び又はホールの発生により導電率が上井す る光楽音楽曲を招く。との様にして各名光領域(

排開昭58-125865(3)

11 R)(11 G)(11 B)は特定収長域の組 射光に応光し、その照射光の健康に対応したレベ ルの信号を出力する。即ち、即配各感光準域(1 1 R)(11 G)(11 B)の出力信号のレベル から入射光の収長成分比を知ることができ、本界 施例の如く光の3原色である赤色・最色・青色の 色フィルタ(15 R)(15 G)(15 B)を用 いることによって全ての色情報を得ることができ

次いて本発明の具体的界面例をその製造方法と 共化説明する。

先ず、産光性電腦(12R)(12G)(12B)としてインソウム結験化物(ITO)がスパックにより設備されパターニングされたガラスから成る原み 0.5 mmの あ光性 悪板 00をプラズマ 反応 何の反応電振聞に配置し、前記 5 光性 悪板 00を約3.5 6 M 日 2 1 0 0 平の高角収電力を付与してグ

ロー数官を生起せしめ印記券だ容易板の上に会面にわたって呼み約100ÅのP型のアセルファスレリコン(αーS1:H)を得る。その数BIH。ガスの分を除去して厚み約5000ÅのI型なーS1:日を析出せしめ、更にフェスフィン(PH))を不能物ガスとして1000PPm 成入し500Å程度のN型αーS1:日を形成し、遊光性暴板の個からPIN各種を重量したPIN扱合を有するアセルファスシリコン(αーS1:日)から成る1枚の光活性層の関連を終了する。尚上記αーS1:Hの成長速度は各種とも約1μ四/ノカアであるので、所領の厚みを得るべく時間額

そして、上記ューS1:日の光活性層はを予め 定められたパターンドフェトエマチング若しくは プラズマエッチング等の手数によって分割する。 この分割によって近接する光活性層(15R)(15G)(15B)尚土は傷実に絶縁された状態 となる。また、上記エマチング手段を使用せず、 マモルファスシリコン形成時に金属マスクを用い

て初めから着択的に分離した光活性層(1 5 R) (1 5 G) (1 5 B) を形成しても長い。

その後、上紀光信性期(13R)(13G)(13B)上にアルミニウムの金貨電低04を取着し不要部を除去して3個の感光像域(11R)(1G)(11B)を前記巻光性基板00の一方の主面に完成する。

上述の如く客光像域(11R)(11G)(118)を形成後、赤色・緑色・青色の各フィルタ(15R)(15G)(15B)を海光性蓄板のの地方の主面に於いて即配各部光像域(11R)(11G)(11B)の欠々と対向するように被増する。斯る赤色・最色・青色の各フィルタ(11R)(11G)(11B)は例えばイーストマンコダック社製の商品名WRATTEN GELA-TIN FILTER M 25(赤色)・M 58(最色)・M 47B(青色)であって、第4図の色フィルタ(15R)(15G)(15B)はフィルム状であり所端パターンに形成後番明な問題系の

れ 後着前で接着する。

また複合を有しない光線電影のものにあっては、S1日4の外のグロー放電により1~10 まクロン例大は5まクロン程度のノンドープ層(I 散層)を相いる。電極配置としては上述の光母電力型のものと向じ光活性層(11R)(11G)(11B)を最大性電低(12R)(11G)(11B)と金銭電低(14R)(14G)(114B)と金銭電低(14R)(114G)(114B)と金銭電低(14R)(114G)(114B)とで装得するものの外に、第5因に示す如く多光性延振のに値優光活性層(11R)(11G)(11B)を設備し、その最出した一主面にの今一対の金銭電低040を所定関係機関して配置せしめたものが存在する。斯る構造による。多光性電低(12R)(12G)(12B)が省略できるのは兄より、如意光性電低の存在による透過光の概かな減衰を回避するとともできる。

第6図(A)四向は本発明感光後便の他の実施例であって、(A)に於いては感光像域(B)が3個、(B)に於いては4個、(A)に於いては6個失々中心対称に集中的必能せしめられ、天々の感光像域(B)…には透

過収長域の異なる光学フィルタ四…が対応するペ く放けられているが、先の実施例の如く赤色・緑 色・青色の光の3原色を用いれば全ての可視光域 をタバーすることができるので、相対感度の低い 収長域の色フィルタ四…を重複して使用すれば低 窓皮を補償することもできる。また感光像域四… が6個存在するものについては赤色・緑色・青色

のる原色と補色の関係にあるシアン色・マゼンタ

色・黄色の色フィルタOS…を追加しても長い。

更に図示はしないが、多数の窓光報域を一直額上に配列した構成が特化カラーファクショリ用の光学数分取り研覧として有用である。この場合、赤色・最色・青色の各色フィルタを備えたる傷の窓光報域を1ユニットとしたものが一直線上に配列される。

め、以上の説明に設けるアモルファス半導体は 反応ガスの組成並びに組成比を過度者択するとと によって感光度特性の異なるものが容易に持られ ることが知られている。例えば反応ガスとして S 1 B 4 Kメタン(C B 4)を加えてモルファスレ 特開昭58-125865(4)

リコンカーバイドを形成すれば、短数美和での思 光度が上昇し、ゲルマン(GBH4)を恋加する ことによってアモルファスシリコンゲルマニウム を持て長数美術での感光度を増大せしめることも

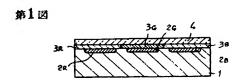
また、最光性電磁(12R)(12G)(12 B)並びに金属電価(14R)(14G)(14 B)は、各配光領域(11R)(11G)(11 B)に対し失々分割せしめられていたが、何れか 一方の電価をアセルファスや事体と同じぐ全領域 に渡って一様に形成しても良い。特に
あ光性電価 (12R)(12G)(12B)を全領域に渡っ て一様に形成すれば、次に重量されるアセルファ ス半導体も平組化されるので有用である。

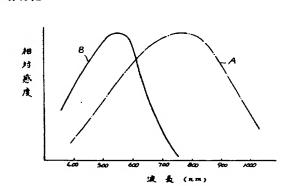
本発明配光装置は以上の説明から明らかな如く、 最光性基板を挟んで感光很長娘の異なる複数の感 光鏡線は、感光度特性が大概ね可視光鏡線に存在 するアセルファス半導体を主機成要業とする光症 性種を含んでいるので、従来の深外領域に態度ピークを有している維納結晶シリコンに於いて不可

欠であった郊外カットフィルタを省略することができると共化、智配産光性基板が施料な光活性層に患影響を与えることなく感光表長数を規制する 光学フィルタを配置せしめる際の保護体並びに支 特体として作用し装置の歩留りの低下を防止する ことができる。

▲ 出面の簡単を説明

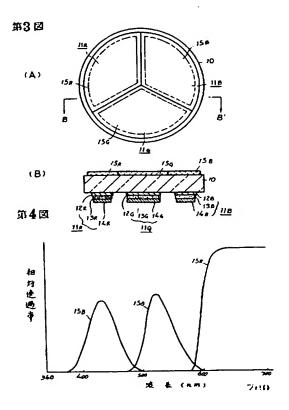
第1回は従来装置の新面図、第2回は従来装置の単結品をリコンと本発明装置のアモルファス半準体の感光度特性図、第3回のは小に設けるB一般新面図、第4回は本発明装置に用いられる光学フィルタの毒適特性図、第5回は本発明装置の他の実施供新面図、第6回(W~均は本発明の更に他の実施供新面図、ま6回(W~均は本発明の更に他の実施供新面図、を失々示している。

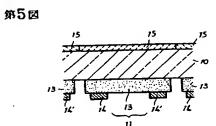


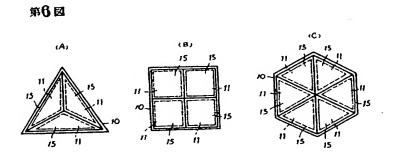


第2四

特開昭58-125865(5)







THIS PAGE BLANK (USPTO)